

ENTE Cはその名が示すとおり、エンジニアリングシステム株式会社のナノインプリント装置開発部隊に与えられたチーム・コード。1994年からナノインプリント装置の開発を開始。入門用の超低価格機、R&D用の高性能カスタム装置、そしてお客様の生産ライン向けの量産用装置と、標準機から特注機まで幅広く製品化を進め、これまでに60台以上の販売実績があります。研究開発用途の装置が多いインプリント装置業界において、当社独自のナノインプリント装置技術と当社の基盤技術の一つであるファクトリーオートーションのノウハウを融合して、お客様の用途にマッチしたコストパフォーマンスの高い装置をご提供してまいります。

**New Product**

## 真空ナノインプリント装置 **EVN-5150** *Vacuum mini*

今年の新製品、バキュームミニ。昨年のセミコンジャパンに参考出展した製品をブラッシュアップして商品化した、UV対応の真空ナノインプリント装置です。

100Paの真空下で一括転写を低価格で実現。モールドは最大6インチ角サイズまで使用可能。大気中のインプリントであれば、最大8インチ角のモールドまで搭載可能です。真空下のUVナノインプリントは気泡の混入を防ぎ、高品質の転写が可能になりますので、試作部品の製作など量産に向けた技術開発に最適です。

### 製品の特長

- 研究開発向けの本格NIL装置
- 真空雰囲気でのインプリント
- 安全&低消費電力のUV-LED
- 空圧シリンダー・プレス機構
- 均一プレスを実現する平行調整機構
- 最大6インチ角のモールド搭載可能
- 設置場所を選ばないコンパクト設計
- 種々の応用が可能なマニュアル操作
- 高いコストパフォーマンス

使用ワーク寸法	最大6インチ角
有効成形寸法	100mm x 100mm
転写力	250~5000N
真空度	約100Pa以下
UV波長・強度	365nm±5nm 6mW/cm <sup>2</sup> (375nm±5nm 10mW/cm <sup>2</sup> に変更可能)
装置サイズ・重量	W650 x D470 x H1300mm(注1) 約200kg (除、真空ポンプ)
ユーティリティ	AC100V(50/60Hz), ドライエア 0.5MPa



注1. 本体写真には架台部分は表示されていません。外観は変更する場合があります。  
 注2. 本仕様は予告なく、変更になる場合があります。

## New Development

# 大面積対応コンパクト UVナノインプリント装置

本年度の第一回ナノインプリント技術研究会において、A4サイズまでのUVナノインプリントを実現したハイコストパフォーマンス装置の発表を行います。拡張性の高い技術による常温・大気中での大面積インプリント装置です。ご期待ください。

当社では各種のナノインプリント装置を開発して商品化を行なっています。その一部をご紹介します。またここにご紹介できない多くの特注装置もございますので、本ページに掲載している商品以外につきましてもお問い合わせください。

## Miniシリーズ

### EUN - 4200

UVインプリントの入門機ながら、100nmクラスのインプリントが可能。UV-LED照明を使用することで、低価格を実現。オールマニュアル装置の特徴を生かして、様々な実験が可能。



### EHN - 3250

### EHN - 3350

材料の選択肢が広い熱インプリントの入門機。AC200Vと水道水をご用意頂ければ、卓上で熱インプリントが容易に実現。ENH3350は最大350°Cの加熱が可能な高温対応機です。



## 各種インプリント装置

### EMF- 010- NI

200kgf、650°Cで加熱されたガラスに微細転写が可能。最大マイクロファクトリーファーストステージ。バイオチップ、マイクロレンズ製造などへ応用可能。



### ERN- 210

ロール・ツー・ロール・インプリント装置。大判・連続・高速転写が可能。両面転写仕様にも対応可能。



カスタム仕様のご要望は下記まで

設計・製造元



エスコエレクトロニクスシステム株式会社

〒399-0033 長野県松本市笹賀5652-83  
TEL.0263-26-1212・FAX.0263-26-1213  
E-mail:sales@engineeringsystem.co.jp

弊社では、さまざまな自動機を設計・製作しております。お客様のご要望に沿った装置を製作します。何なりとお問い合わせください。